電子エネルギー分析

Analysis of Electron Energy



内 容 梗 概

物質薄膜を通過した電子のエネルギー分布を測定しうる高分解能電子速度分析装置を試作し,各種の物質について測定した結果をまとめた。すべての物質はそれぞれ固有のエネルギー損失値を有し,その値は10ないし 25 eV の範囲にあることがわかった。

同装置の応用として一定エネルギーの電子のみによる電子顕微鏡像を得て,通常の電子顕微鏡像は弾性散乱 電子のみならず,非弾性散乱電子が大きく寄与していることを確かめた。また,従来非弾性散乱電子は干渉し ないものと考えられていたが,結晶内部でプラズマ振動を励起した電子は干渉性を失なうことなく終像に寄与 していることを見出した。

----- 8 ------

1. 緒 言

「固体による電子の散乱」ということは,物理学の各分野と密接な つながりを持つ。たとえば,電子回折法は物質と電子の相互作用を 通じて,物質の原子配列を知る有力な方法であり,また最近重要視 されてきた電子顕微鏡の像形成は,試料による電子の微小角散乱の 知識がなくては論じられない。その他,電子線による写真乳剤中の



潜像形成,物質中の電子の飛程,二次電子放射,導体および半導体 の電気抵抗,電子波のPolorizationなど数多くの問題に関係する。

これらの問題でまず必要なものは、加速電圧Vの電子が物質 a (状態も含めて)によって散乱されるときの散乱強度 $I_a を$ 、散乱角 $\theta と$ 散乱後のエネルギー $V - \Delta V$ の関数で表わしたもの、 $I_a(V, \Delta V, \theta)$ である。この報告では、 $V=10^2 \sim 10^5 \text{eV}$ 、 $\Delta V \leq 50 \text{ eV}$ 、 $\theta \leq 10^{-1} \text{ rad}$ の範囲における I_a の測定およびその結果の解釈に触れたい。この範囲は、普通電子線回折、電子顕微鏡で使われるものである。

50 eV 以下のエネルギー損失は、主として価電子による非弾性衝突によって起こり、 I_a は価電子のエネルギー状態に関する知識を与える。マイクロ波や、光の吸収から得られる知識は、高々数 eV までのエネルギー状態であるが、電子の場合の I_a は、それに続く高いエネルギーの状態の知識を与える。Pines⁽¹⁾の予想した固体内電子のプラズマ振動は、エネルギーが高いため、photon あるいはphononでは励起されないが、上述の範囲の電子線では励起され、ある種の金属では、 $I_a(V, \Delta V, \theta)$ は $\Delta V = \hbar \omega_p (\omega_p \text{はプラズマ振動数})$ の近傍に大きいピークを持つことが実験で確かめられた。かくして $I_a(V, \Delta V, \theta)$ の測定によって、固体内電子のプラズマ振動の存在が確認された。これに刺激されて、現在上述の範囲における $I_a(V, \Delta V, \theta)$ の測定、計算が多くの人によって行なわれている⁽²⁾。

価電子による非弾性散乱の確率は, 殻内電子の場合に比べて大き い。電子回折のバックグラウンドを形成するものは, 主として価電 子による非弾性散乱電子である。このエネルギースペクトルを得る ことは, 非弾性散乱電子の関与する菊池像の問題などの理解に大い に役だつ。また特殊なものであるが, 電子顕微鏡像の色収差の問題 もエネルギー損失の大きさや, それを伴った散乱電子の角度分布に 関する知識を必要とする。 mm離して平行に置き、両側を接地して中央電極に加速電圧に近い 負の高圧をかけたものである。このレンズは一般に磁界レンズに比 べて各種の収差が大きい。エネルギー分析器としては平行に入射し て、平行に出てゆくようなビームを使う。このビームは望遠鏡的通 路 (Telescopic Path)を取るため、加速電圧の変動に対し敏感に方 向を変える。レンズの強さを固定しておき、加速電圧Vのときに望 遠鏡的通路を取ったビームは、V+4Vで軸に対しrなる角度を持 つとする。Glaser⁽³⁾は $r / \frac{4V}{V}$ を離軸距離 r_0 の関数として計算し た(第1図)。 $r_0=1$ はレンズ孔の縁を示す。 r_0 の大きいほど、分析 器としては大きい分散が得られる。普通は r_0 を 0.4 ないし 0.6 くら いに取る。たとえば $r_0=0.6$ として4V=V、V=50 kV を入れると 第1図から $r\cong 2 \times 10^{-2}$ rad が得られる。それゆえ分析器から像面ま での距離が 500 mm の装置を使えば 10 mm/V の大きい分散が得ら れる。もちろんこれは理想的な場合の話であって、われわれの装置 は V=35 kV で、0.5~1 mm/V の分散を持つ。

上では細い一本のビームを考えたが,エネルギースペクトルとし ては光のスペクトルのように線状,あるいは帯状のものが望ましい。 そのためレンズの円孔を細長い孔にし,その長さの方向に,平行に 非常に細いスリットを置く。分析器にはいるビームのroが一定とな り,横方向にのみレンズ作用を受けて直線像を作る。加速電圧のわ ずかに異なる電子はそれに平行な位置に集まる(第2図)。

上述の装置は、試料後方に置かれた絞り孔の中へ散乱された全電

以下,第2章でエネルギー分析装置を紹介し,第3章ではその実験結果を,第4章でエネルギー分析と電子顕微鏡を組み合わせた装置および第5章でそれにより得られた結果を報告する。

2. エネルギー分析装置

静電形単レンズは普通,円孔を持った3枚の電極を数ないし十数 * 日立製作所中央研究所理博 子について平均された,エネルギー損失を測るものである。実際に は散乱角とエネルギー損失の両者を知ることが望ましい。もちろん 小さい絞りを中心から次第にズラせ,いろいろな散乱角においてエ ネルギースペクトルを撮れば,散乱角との関係は求められる。ここ では同一乾板上に,散乱角とエネルギー損失の大きさを同時に記録 できるようにしたものを紹介する。 原理は,さきの第2図のスリット面上に試料の回折像を作り,直径



第2図 Möllenstedt 形分析装置の原理図





第4図 Al 薄膜による40 kV 電子の エネルギー損失と散乱角の関係



部分だけをスリットで拾い出して分析器に入れる。 Möllenstedt 形 分析器はスリットの長さの方向にはほとんど作用しないが,横方向 には分析器として働らく。第3回はその電子線径路を示す。(b)図 はスリット面上の電子回折環,(c)図はそのとき得られるエネルギ ースペクトルである。(c)図の横軸はエネルギー損失,縦軸は散乱 角を与える。第4回はその実例を示す。試料は約250ÅのAI 蒸着 膜,加速電圧 40 kV である。この写真の各点の強度測定を行なえば 散乱強度 $I_0(V, 4V, \theta)$ が求まる。第5回は上の写真から求めた,散 乱角(x -軸),エネルギー損失(y -軸),散乱強度(z -軸)の関係 を示す立体模型である。この装置はエネルギー分解能1/25,000,散 乱角の測定精度 2×10⁻³ rad,測定しうる最大エネギー損失約100 eV,最大散乱角10⁻¹ rad である。将来改良の余地はある。

3. エネルギー損失値の実験結果

3.1 エネルギー損失の大きさ

第1表は最近まで得られたエネルギー損失の値と概略の相対強度

第5図 Al 薄膜による25 kV 電子の散乱強度(z 軸)の 散乱角(y 軸)とエネルギー損失(x 軸)に対する関係

55 1					1.	+11	14.	1.1.
ET.	10	-1-	1	12	3-	 10	-k-	1111
11 1	- 25			100	1	114	1	111



をまとめたものである。注目すべきことは、すべての物質がとにか	1. Ruthemann5. Kleinn2. Lang6. Watanabe
く 15~30 eV のエネルギー損失のピークを持っていることである。 ただ測定値が測定者によって異たる古け問題を含んでいる。その原	 Möllenstedt Marton and Leder Marton and Leder
因と考えられるのは, (i)観測中の試料の変化, たとえば電子照射	のを見ていること,などである。これらの点に注意して,もっと信
中の温度上昇,酸化,コンタミネーションなど,(ii)エネルギース	頼度の高いデータを集めることが望ましい。 22 サモタトエネルギー提生使の関係
リールの不元至さ、(III) 敢乱再をとこまで取ったかが一定していな いこと、(iv) 分解能不足のため、何本かのピークをぬりつぶしたも	3.2 畝乱角とエイルキー損失値の関係 非弾性散乱電子の数は、散乱角が増すとともに、減少することは
9	

日立製作所中央研究所創立二十周年記念論文集

	xo (測定值)	xo (計算值)	<i>a</i> (測定值)	<i>α</i> (計算值)	
Be	3.8×10-4	3.8×10-4	0.42 ± 0.04	0.55	
Mg	2.1	2.2	0.62 ± 0.04	0.44	
Al	3.0	3.2	$\textbf{0.50} \pm \textbf{0.05}$	0.45	
Ge	3.3	3.1	$\textbf{0.83} \pm \textbf{0.15}$	0.45	
С	10				
(グラファイト)	1.5	4.9	$\textbf{1.0} \pm \textbf{0.3}$	0.50	

第2表 エネルギー損失値およびそれの散乱角への依存 (エネルギー損失値は2V=50kVを単位として表わしてある)

一般に知られている。われわれの1955年の実験は⁽⁴⁾エネルギー損失 の大きさが散乱角とともに増す場合のあることを示した。**第**4図の 写真で認められるアーク状の部分がそれである。エネルギー損失値 14.8 eV に対応するが、これは明らかにエネルギー損失の値が散乱 角とともに増すことを意味する。 θ の方向へ散乱された電子のエネ ルギー損失値を $\Delta V(\theta)$ と書けば、 $\Delta V(\theta)$ は実験的に

 $\Delta V(\theta) = \Delta V_0 + a \,\theta^2$

の形で表わされる。ただし ΔV_0 は $\theta = 0$ のときのエネルギー損失値 で、第1表に与えられている値に近い。第2表は加速電圧の2倍を エネルギーの単位に取って測った。 $x^0 = \Delta V_0 / V$ および a の値を示 す。

3.3 最大散乱角

第4図のアークはある散乱角のところで切れている。このアーク





の切れるところを最大散乱角 θ_{max} と呼ぶ。あるエネルギー損失を伴った電子はこの角度以上の方向変化は受けないことを意味する。第 4 図 について測定した値は 1.5~1.8×10⁻² rad であった。

3.4 実験結果

エネルギー損失のピークを次の三つのグループに分ける。

(1) Be(19 eV), Mg(10.3 eV), Al(14.8 eV), Ge(16 eV) およびグラファイト(7 eV)。これらのピークはすべて、(i)シャープで強度の大きいこと、(ii)散乱角とともに損失の大きさが増すことを特長とする。

(2) Cu(19.5 eV), Cr(26 eV), Fe(23.2 eV) などの貴金属, 遷移金属に見られるピーク。特長は, (i)幅は広く, 強度の大きいこと, (ii)散乱角に対するエネルギー損失値の依存性は認められないことである。

(3) Ag(3.4 eV), Al(6.5 eV), Au(6.5 eV)などのピーク。特長は、(i)シャープであるが強度は小さいこと、(ii)エネルギー損失値も小さいことである。

4. 電子速度選択装置付電子顕微鏡

(Electron Spectro-Microscope)

これまでの各章で、電子線の非弾性散乱およびその際のエネルギ ー損失について述べた。実際の電子顕微鏡像には、弾性散乱電子の みならずいろいろの値のエネルギー損失を受けた非弾性散乱電子も 寄与している。後者の寄与の仕方(たとえばコントラストに対する) はエネルギー損失値や散乱角度分布のみでは決まらない。すなわち 非弾性散乱後には干渉性を失ない単なるバックグラウンドになって しまうか、弾性散乱波に似たコントラストで像形成をするかの問題 が生ずる。この点につき実験的に調べるため、速度分析装置を利用 (偏向板D₁, D₂には逆位相ののこぎり歯状波を加えておく)

と非弾性散乱電子とは分離され、第2スリットS2の面上では相異な る場所に集まる。S2を移動させて任意のエネルギーを有する電子の みを拾い出し、円筒レンズ Lc によって速度分析器Aによる像のひ ずみを補正すれば(Aは非点収差の大きいレンズである),終像Sの 上には特定エネルギーの電子(単色電子と呼ぶ)のみでできた像が 作られる。このとき分析器Aと補正レンズ Lc によって第1スリッ トSiは終像蛍光板Sの上に写像されるように各レンズの焦点距離は 調整されている。しかし、これでは視野の大きさはS1で限られてい るため、試料のごく一部分しか見られないという不便さがある。こ の不便さをなくすために第1および第2偏向板D₁, D₂にたがいに逆 位相ののこぎり歯状波(あるいは三角波)を加えて中間像と単色電子 線による像とを左右に振り,広い視野を得るようにする。単色電子 のエネルギーは第2スリットS2の位置を調整することにより任意に 選べる。またエネルギー分解能, すなわち単色化の程度は第2スリ ット S2 の幅で決まり像の解像度は対物レンズL0,分析器Aおよび補 正レンズ Lc の諸収差によって決められる。第7図は今回の予備実 験装置の外観を示す。本装置の主要部分は電子速度分析装置であ り,2で述べたようにスリット状の電極孔を有する静電レンズに固 有の大きい色収差を利用して、電子のエネルギー損失のスペクトル を得るものである。静電レンズには加速電圧に近い負の高電圧を印 加する必要がある。現在の装置では静電レンズ部の絶縁に問題があ り、印加電圧は最高40kVであるので、以下に示す写真はすべて 40 kV の加速電圧で得られたものである。単色電子のエネルギーは 加速電圧およびそれより 100 eV くらい低いものまで選ぶことがで き, その分解能は 1 eV 以下である。レンズ系全体による総合倍率

して,以下に述べる特定エネルギーの電子のみにより結像させる装置 (ESM と略称)を作り,観察を行なった。

4.1 ESM 実験装置

第6図は ESM の電子光学系を示す。試料Cによって散乱された 電子は対物レンズ L₀によって,第1スリット S₁の面上に中間像 I₁ を作る。S₁で拾い出された像の一部分を形成する電子のエネルギー をエネルギー分析器Aによって分析する。その結果,弾性散乱電子

5. ESMによる実験結果とその検討

は約5,000倍であり、200~300Aの解像度が得られている。

5.1 コロジオン膜上のカーボン粒子
第8図はコロジオン膜上に分散したカーボン粒子の像を示す。
(a)は普通の明視野像,(b)はエネルギー損失のない電子のみによる像 (no-loss electron image), (c)は23 eV の損失を伴った非弾





トはあまり変化するものではなく,定性的には(a)は(b)と(c)の 重なり合ったものと考えてさしつかえない。

5.2 フレネル干渉縞

第9図はコロジオン膜孔の過焦点写真を示す。(a)は明視野像, (b)は弾性散乱電子による像(c)は約23eVのエネルギー損失を伴 った非弾性散乱電子による像である。ここに注目すべきは(a)およ び(b)にはフレネル干渉縞が認められるが, (c)には認められない ことである。 従来, 焦点をずらした電顕像に認められるフレネル縞に関しては Boersch⁽⁵⁾ が最初撮影して以来,多くの研究者によって取り扱われ てきた。しかし、計算はすべて可干渉波のみに関するものであり、 そこから得られたフレネル縞のコントラストは、非干渉波の成分を 多量に含んだ普通の電顕像のコントラストとは合わないものであっ た。第9図(c)に見られるような非弾性散乱電子によるバックグラ ウンドを考慮に入れなければ、実際の電顕像におけるフレネル縞の コントラストは説明できないものである。第9図(b)にフレネル縞 の部分の強度比較した結果を示す。上述のように(a)と(d)の強度 は直接比較できないが膜孔の中央部においては散乱波はなく,入射 波のみがくるものと考え、そこの電子線強度は(a)と(b)で相等し いとして(a)図を得た。(b)の曲線は(a)に比べて膜の部分と膜の ない部分の強度の比が大きく、(b)の写真は(a)よりコントラスト の高いことがよくわかる。さらにこのコントラストの差は膜孔の縁 から膜の部分にかけて増加してゆく(c)の曲線で代表される非弾性 散乱電子によるものであることも明らかである。 第9図の写真は著しくボンヤリしたものであるが、これは結像に あずかる波が非可干渉的のために起こるのである。すなわち,可干 渉波のときには膜の縁の位置から一定の距離に明るいフレネル縞が 現われるが,非可干渉波では一様に強度が落ちるため縁がボケて見 えるのである。一般の非弾性散乱波によってフレネル縞ができるか いなかの問題については別に議論する。現在までのところでは、そ のようなフレネル縞は観測されていない。





(2)	旧相野侮
(a)	切扣到了

(b) no-loss 電子像

(c) 23 eV-loss 電子像

第8図 コロジオン膜上のカーボン粒子

性散乱電子による像(23 eV loss electron image)である。コロジ オン膜では23 eV の損失が最も起こりやすいのでそれを用いた。 (a)と(b)は一見したところ,ほとんど差はなく,この試料の明視 野像は主として弾性散乱電子によって作られていることがよくわか る。コロジオン膜の厚さは100~300Å程度と推定され,この膜で は非弾性散乱の確率は小さく,形像に寄与するものは大部分弾性散 乱電子であるといえる。(c)の非弾性散乱電子による像は暗視野像 に類似したものである。像の明るさは膜孔の部分では当然のことな がら暗く,膜厚が増すにつれて増し,カーボン粒子の部分では再び 真暗になる。 一般の電顕像は(b)の像にいろいろな値のエネルギー損失を伴っ た電子による(c)のような像が重なったものである。(c)はエネル ギー損失値の大きさによって全体の強度は変化するが,コントラス

5.3 等厚干涉縞

第10図は電解法で作製したAI薄膜の像を示す。孔の周縁の黒白の線は等厚干渉縞である。(a)明視野像,(b)弾性散乱電子による像,(c)15eVの損失を伴った非弾性散乱電子による像のいずれにも等厚干渉縞が認められ、しかもそれがほとんど同じ場所に位置していることは注目すべきことである。(c)の写真は一見したところ暗視野像によく似ているが、暗視野像では縞の位置が明視野像と半周期ずれて、縞の山と谷の位置が入れ換わる。(c)の写真で膜厚のごく薄い所を除いては、山と谷の位置が明視野像と一致している点、普通の暗視野像と異なる。



(a) 明視野像 (b) 弾性散乱電子による像 (c) 非弾性散乱電子による像



ることはよく知られている。(c)の写真において等厚干渉縞が明り ょうに認められることは、15 eVの損失をともなった非弾性散乱電 子(plasma 振動を起こした電子)が干渉性を有していることを意味 している。このことについてはすでに述べたが,第10図(c)の写真 は最も端的に plasma 振動を励起した非弾性散乱電子の可干渉性を 示すものである。第10回は明視野像との対応も明確にわかるので 非弾性散乱電子の可干渉を確認するものである。第10図の(b)と (c)を比べてみると縞の位置に関して次のことがわかる。試料の厚 い部分においては弾性散乱電子による像(b)も,非弾性散乱電子に よる像(c)も同じ場所に縞が見えるが膜孔の周線における試料の薄 い部分では多少ずれ位置に見える。これは定性的に次のように説明 できる。試料の厚さを t とすると、 t=0では(b)には多量の透過波 があるため像のその部分は明るく, t が増すにつれて弾性散乱波は 回析方向にゆくものが増すため像は次第に暗くなる。一方, (c)に ついては、t=0で非弾性散乱電子がないため像は真暗であり、tが

増すにつれて非弾性散乱電子が増すので像は明るくなる。しかし, その増大した非弾性散乱波も結晶格子面によって反射され、回析方 向にゆくものが多くなるため、試料の下の入射電子の方向におかれ た対物絞りにはいるものは少なくなり,干渉縞の谷の部分ができる。 plasma 振動を励起した非弾性散乱電子の波長は入射波の波長とご くわずかしか(加速電圧 50 kVの入射波に対して Δλ/λ~1.5×10-4) 変化していないので、入射波がある格子面でBragg条件を満たして いるときには plasma 振動を励起した非弾性散乱電子もその面でほ とんど Bragg条件を満たしていると考えてよい。それゆえ,その面 で反射した非弾性散乱電子の等厚干渉縞は弾性散乱電子の等厚干渉 縞と同じ位置に出るものと考えられるが,試料の非常に薄い部分で は一方の強度は0から出発し、一方は100%から出発するので弾性 散乱電子による最初の谷までの間に, 非弾性散乱電子では強度の山 ができることになる。

6. 結 言

以上固体による電子線の非弾性散乱に関し実験装置および得られ た結果について述べた。特に単体金属によるエネルギー損失の位 置, 散乱角のデータを紹介した。また非弾性散乱の電子顕微鏡像へ の影響を調べた結果,次の重要な結論を得た。(1)弾性散乱電子の みで作った像は普通の電顕像より高いコントラストを示すこと, (2) フレネル干渉縞は弾性散乱電子による像のみに認められる,

(3) 一部の非弾性散波(プラズマ振動を励起した波はその典型)は 干渉性を失うことなく等厚干渉縞を作ること。(1)の点は、すでに Boersch が electron filter を用いて実験的に確かめたものである が、(2)および(3)の結果は本 ESM によって初めて明らかになっ たものである。

考 献 文 参

- (1) D. Pines and D. Bohm: Phys. Rev., 85, 338 (1952)
- (2) L. Marton et al: Advances in Electronics and Electron Physics., Vol. VII, 183 (1955)
- (3) W. Glaser et al: Optik., 11, 445 (1954)
- (4) H. Watanabe: Journal Phys. Soc. Japan, 9, 920 (1954) H. Watanabe: Journal Phys. Soc. Japan, 11, 112 (1956)
- (5) H. Boersch: Z. f. Phys., 134, 156 (1953)

許の紹 特 介 特許第29855号(特公昭36-20426) \equiv 浦 武 雄

多チャンネルデータ集合計量装置

この発明は、多チャンネルアナログ信号をそれぞれディジタル信 ディジタル変換器の比較器のみを各チャンネルごとに設け、上記各 よりクロックパルスの通過を制御するゲート回路は, 各チャンネル チャンネル切替器をそう入した場合に問題となる精度の低下を防 ぎ、しかも比較器以外は、各チャンネル共通としたことにより装置

